

理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 吉田光一 OHO '23



- •はじめに
- RIビームの生成、分離、収集
 - RIビームの生成
 - RIビームの収集、分離
 - RIビームの同定
- RIビーム用生成ターゲット
 - RIビーム生成用ターゲットの特徴
 - RIBFのRIビーム生成ターゲット
- ・まとめ

はじめに

原子核とは、
 陽子と中性子が核力で結びついた集合体
 陽子数、中性子数の組み合わせで、
 性質決まる。

約7,000個存在する。

安定核(寿命∞) 251個 (寿命>46億年)35個

それ以外、

- 有限の寿命で、放射線を出して崩壊 不安定核、Radio Isotope RI
 - これまで約3300個見つかっている。 既知のRI

大数

BigRIPSで発見したRI (157個)

・安定核の核反応で生成



RIビーム

- RIビームとは、RI(不安定核)をビームとしたもの。
 - RIを加速器で加速、RIビームとする。
 - 加速器で加速された安定核ビームから核反応によりRIを生成、これを収集、 分離してビームとする。
- ・理化学研究所RIKEN RIビームファクトリー(RIBF)
 後者のRIビームライン:超伝導RIビーム生成装置 BigRIPS





超伝導RIビーム分離生成装置BigRIPS

▶ 大アクセプタンス • ウランの飛行核分裂片の広がり(RIBFエネルギーで ±50 mr, ±5%) をほぼカバー ▶ 超伝導を使った大口径の四重極電磁石 ポールチップ径=17 cm, ポールチップ磁場 = 2.4—2.5 T ▶ 2段構成のセパレータ ▶ 第2ステージの分解能が高い Parameters: 全運動エネルギーを測定しなくても、粒子識別可能 $\Delta \theta = \pm 40 \text{ mr}$ $\Delta \phi = \pm 50 \text{ mr}$ $\Delta p/p = \pm 3\%$ From SRC Two-stage $B\rho = 9 \text{ Tm}$ separator L = 78.2 mTarget F0 Wedge Beam dump STQ1—14: F1 Wedge TQ N Superconducting F7 F2 F3 STQ10 D4 STQ9 STQ8 ر STQ11 D3 STQ7 STQ6 STQ6 STQ5 D2 Q triplets TQ12 STQ15 D1—D6: Dipoles (30 deg.) 2nd stage 1st stage F1—F7: Focuses 生成 & 分離 粒子同定・2段階分離



第1ステージ



第2ステージ

RIビームの生成

100MeV/uを超える重イオンビーム原子核がターゲット原子核と核反応を起こして RIが生成。

入射核破砕反応



ビーム原子核よりも小さい、多種多様なRIが 破砕片として生成





入射ビームの運動量が大きい(重イオン、高エネルギー)ので、破砕片/核分裂片は ビーム速度とほぼ同じ速度で前方に集中する。→ ビームとして利用できる。

RIビームの分離



⁴⁸Caビームから¹⁸Cを作る

- ターゲット
 入射核破砕反応により⁴⁸Caより軽いRIが生成。
 - ・ 生成したRIの速度Vは、ビームの速度とほぼ同じ。
- STQ1-D1-STQ2で磁気剛性を分析、F1へ 磁気剛性= $\frac{運動量}{Z} = \frac{Am_u\gamma\beta c}{Z} \propto \frac{A}{z}$ なので • D1で反応しなかった安定核ビームを磁気剛性 の違いで分離し、ビームダンプで止める。

• A/Z=3のRI (¹⁵B, ¹⁸C, ²¹Nなど) はスリットを 通過しエネルギー減衰板に入る。 荷電粒子のエネルギー損失(Bethe-Blochの式) $-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi}{m_e c^2} \frac{nZ^2}{\beta^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \left[ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2}{l(1-\beta^2)}\right) - \beta^2 \right]$ • RIのZ²に比例するエネルギー損失。 • 通過後、Zによって異なるエネルギー、磁気剛性 になる。

- になる。 • STQ3-D2-STQ4で再び磁気剛性を分析、F2へ
 - Zの違いによりさらに分離、¹⁸Cが選び出される。

エネルギー減衰板 荷電粒子のエネルギー損失 $-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi}{m_e c^2} \frac{nz^2}{\beta^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \left[ln\left(\frac{2m_e c^2\beta^2}{I(1-\beta^2)}\right) - \beta^2 \right]$ 粒子のエネルギー(運動量)が小→エネルギー損失 大 粒子のエネルギー(運動量)が大→エネルギー損失 小 F1 分散のある焦点:運動量の違いが位置の違いになる。 クサビ形 平板 減衰板なし P₁ −3. 5% $P_0 - 3\%$ $P_1 - 3\%$ $P_0 - 3\%$ $|P_0 - 3\%|$ $P_0 - 3\%$ P₁ +0% P₁ +0% P₀ +0% P₀ +0% P₀ <u>+0%</u> P₀ +0% P₀ +3% P₀ +3% $|P_0 + 3\%|$ P₁ +3.5% P₀ +3% P₁ +3% 分散変わる。 分散を保つ。

分散を保っておくとビームラインの調整が楽。 中心運動量の変化分のBpスケーリングで済む。



RIビーム生成用ターゲットの特徴

- ターゲットの材質
- ターゲットの厚さ
- ターゲット中でのビーム発熱

*ターゲットは真空中に置かれる。(ビームを余計なものに当てない。)

ターゲットの材質

•入射核破砕反応用

入射核破砕反応の断面積:ターゲット原子核の種類にほとんどよらない。 →ビームに対する影響(エネルギー損失、多重散乱)を考えると軽い原子 核が有利。 ベリリウム、炭素が主に使われる。

- •²³⁸Uの飛行核分裂
 - 核破砕一核分裂
 核破砕反応と同じく、軽い原子核のターゲット
 - クーロン励起一核分裂
 原子核の周りの強いクーロン場を利用するため、陽子数Zの大きなターゲット
 金Au(Z=79)、鉛Pb(Z=82)が多いが、RIビーム生成向けにはタングステン W(Z=74)(高融点)

ベリリウム(もしくは炭素)を主に、²³⁸Uのクーロン励起核分裂 向けにタングステンを用意すれば、よい。

生成ターゲットの厚さ

- ・厚い方がRIの生成率大きい。
- ・ターゲット中での反応点の違いでRIのエネルギー広がる。
 - エネルギー損失(安定核ビーム)>エネルギー損失(生成したRI)なので、 ターゲット入ってすぐ反応 RI エネルギー大 ターゲット出口付近で反応 RI エネルギー小
 - •反応による運動量の広がりにターゲット中の反応点による広がりが加わる。

ターゲット

安定核

安定核

RI

RI

安定核

- 厚いターゲットでは多重散乱によってビーム広がる。
- ターゲット通過後のRIビームの磁気剛性と、未反応安定核 ビームの磁気剛性が一致しないようにする。

⇒生成に使う安定核ビームと生成するRIビームとの関係で適切な厚さを 選択する必要がある。 安定核

経験的には安定核ビームの飛程の30-50%を使うことが多い。
 ²³⁸U 345MeV/u Be 飛程13mm 4~6 mm厚さ
 ⁴⁸Ca 345MeV/u Be 飛程52mm 15~30mm厚さ

いろいろな厚さのターゲットをビームタイム途中で切り替えて使う必要 がある。

ビームによる発熱量

- RIビームの生成ターゲット
 - 大強度~1 particle μAの重イオンビーム(²³⁸Uまで)の照射
 - ビームサイズ \$\phi 1 mm
 - ビームのエネルギー損失による発熱 18kW
 (2381) 245 MoV/(11 1pt/ 4 mm 厘 *)

(²³⁸U 345 MeV/u,1pµA,ベリリウム4mm厚さ) ⇒熱密度 5.7kW/mm³ ベリリウム 密度p=1.85g/cm³、比熱c_p=1.82 W/Kg ビームスポットから熱が逃げないとすると、

1ms で1700°Cの温度上昇。(融点1287°C)→除熱ムリ。

ターゲットを回転させて、熱密度を下げる。 半径150mm程度で回転させると、熱密度を1/1000に 下げられる。

回転スピードは熱拡散に比べて十分早くすれば、円周上に ほぼ均一に熱を広げられる。



固定ターゲット



回転ターゲット



熱輻射 ステファン・ボルツマンの法則 $E = \epsilon \sigma T^4 (W/m^2)$ $\epsilon:輻射率$ $\sigma:ステファン・ボルツマン係数$ $5.67x10^{-14} (W/m^2 K^4)$ T:絶対温度(K)

円周状に広げたビームスポット から18kWの熱を輻射で逃がす。 輻射面積(ビームスポット面積) S=2π x 150mm x 1mm x 2面 = 1885 mm² ε=0.8 (炭素) E=18kWをいれると、 T = 3800 K

(炭素:昇華点 3915 K 実際には、熱伝導で輻射面積 広がる。2倍になるとT=3200K)

BigRIPSの生成ターゲット

- 伝導冷却式の水冷回転円盤ターゲット
- RIBFの¹²C-²³⁸Uビーム 345MeVu、1pµAに対応(目標)
- RIビーム生成効率の高いベリリウムをターゲットに採用
- •2つの回転ターゲットユニットで最大15種類のターゲット厚さの選択に対応。
- ターゲットチェンバーの側面フランジに主要な機構を搭載。専用台車を使って、 容易にビームラインから取り出してメンテナンス可能。



BigRIPS回転ターゲット詳細



- ロータリージョイント
 回転軸への冷却水導入。回転軸に炭素板をばねで押し付けて水をシール。(真空はもたない。)
- モーター IPMモータ、センサレスで回転数制御 100-1000rpm
 磁性流体シール

回転軸の真空シール、軸周りの磁性流体で真空シール。

回転ターゲットユニット





ターゲット本体

サイズ Ø30cm 材質 Be,(W) 厚さ 10-15-20 mm 5-7-10 mm 2-3-4 mm

← Be : 20,15,10 mm thick

ターゲット温度測定機構

Target chamber (upper view)





温度の校正: 輻射率、光路の減衰を補正

40.0 °C

36.9

33.8

30.7

27.6

24.5

21.4

18.3

15.2

Be 15mm, 48Ca 420pnA, <u>100rpm</u> 1.3kW heat -> Beam spot 84°C

Rotating target

ヒーター、ベリリウム板、 熱電対をターゲットラダーに マウントし温度校正 ANSYSによる回転ターゲットの除熱計算

回転ターゲットの詳細構造を取り込んだ伝熱計算:ANSYS WorkBench Mechanical



ANSYS計算結果

•²³⁸U 345MeV/u 1pµAを4mm厚さベリリウムに照射

入熱量 18kW,ターゲット回転数300rpm





•⁷⁸Kr 345MeV/u 280pnAビームを Be 10mm、 300rpmに照射



カメラ観測温度:48°C 輻射率、光路の減衰の補正:106°C相当

ビームスポット温度:101°C

ビームスポット温度は良く再現。 ⇒ 熱伝達率などのパラメータはおおむね妥当。

除熱能力評価

- 各種厚さのターゲットで、²³⁸U 345 MeV/u 照射のビームスポット温度 を計算。
 - 2-3-4 mmターゲットは融点を超え ない。
 - 厚い5-7-10mmは600pnAで融点こ える。
- 設計目標1pμAを少し下回る。
 - 現在のRIBFのビーム強度目標²³⁸U
 300pnA 他1pµAには十分
 - 4mmを超える厚さは2つの回転 ターゲットを重ねて使う。
- •現在のターゲットの改良点
 - 回転数を増やす。
 300rpm→1000rpmで、スポット前後の温度差200°Cは1/3に。
 - ターゲットと冷却円盤の熱接触の 改善 銀箔などを間に挟む。現状温度 差540°Cと計算されているので、効 果大





- ・回転ターゲットシステム2006年にBigRIPSとともに、完成。 当初はもっぱら固定ターゲットを使用。
- •2015年以降、SRCのビーム強度増加に伴って、回転ターゲットの使用が本格化。
- 2018年に1-2-3、4-6-8 mm厚さのベリリウムターゲットを追加整備。これによって、ベリリウム1~11mmまで1mmステップで選択可。⇒この組み合わせで⁷⁰Zn, ⁷⁸Kr, ¹²⁴Xe, ²³⁸Uビームに使用。
- これまでに使用した最大ビーム強度とその時のターゲットへの入熱量
 ⁴⁸Ca 500 pnA
 2.1 kW

⁷⁰ Zn 800 pnA	3 kW
⁷⁸ Kr 600 pnA	2 kW
¹²⁴ Xe 160 pnA	1.2 kW
²³⁸ U 100 pnA	2.1 kW

 これまで回転ターゲットに大きなトラブルなし。順調に使用。
 (周辺機器(真空ポンプなど。)にはいくつか故障発生。放射線ダメージ 起源か。)

まとめ

- RIビームの生成・分離をBigRIPSを例に紹介。
 - 大口径のビームライン
 - ・磁気剛性の分析2回、間にエネルギー減衰板をいれて、RI選択
- RIビーム生成用ターゲットの特徴を紹介。
 - ベリリウム、タングステン製
 - •厚さ容易に変えられる。
 - ビームによる発熱が大きいので、除熱が重要。
- BigRIPSの生成ターゲットに詳細構造を紹介。
 - ベリリウム製の水冷式回転ターゲット
 - 除熱能力²³⁸U 1pµAに対応できるのは、厚さ4mmまで。
 それ以上は、2台に分散。
 - ターゲット本体と冷却板の熱接触の改善を試みたい。

謝辞

- BigRIPSの回転ターゲットシステムは、2006年までに、理研の 久保敏幸氏と、吉田敦氏によって、開発、建設されました。両 名に深く感謝します。
- BigRIPSの回転ターゲットシステムは理研仁科センターの柳澤 善行さんをはじめとするBigRIPSチームの皆さんで、運用、維 持されています。皆さんの日々のご尽力に、深く感謝します。